

488696-2026 - Wettbewerb

Irland – Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser) – LA3215C-UCC-CFT
for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition Tools, 4 Lots

OJ S 134/2026 15/07/2026

Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung - Änderungsbekanntmachung
Lieferleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Education Procurement Service (EPS)

E-Mail: info@educationprocurementservice.ie

Rechtsform des Erwerbers: Einrichtung des öffentlichen Rechts

Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: LA3215C-UCC-CFT for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition Tools, 4 Lots

Beschreibung: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Kennung des Verfahrens: a024c275-b92f-48d9-83b8-52aa370660c8

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Lieferleistungen

Haupteinstufung (cpv): 38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)

2.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): South-East (IE052)
Land: Irland

2.1.3. Wert

Geschätzter Wert ohne MwSt.: 3 300 000,00 EUR

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

2.1.5. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Bedingungen für die Einreichung:

Höchstzahl der Lose, für die ein Bieter Angebote einreichen kann: 4

2.1.6. Ausschlussgründe

Quellen der Ausschlussgründe: Auftragsunterlagen

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: Plasma Etcher ,Silicon ,Dielectrics

Beschreibung: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Interne Kennung: 1

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Lieferleistungen

Haupteinstufung (cpv): 38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)

5.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): South-East (IE052)
Land: Irland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Laufzeit: 48 Monate

5.1.5. Wert

Geschätzter Wert ohne MwSt.: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Allgemeine Informationen

Vorbehaltene Teilnahme:

Teilnahme ist nicht vorbehalten.

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.9. Eignungskriterien

Quellen der Auswahlkriterien: Auftragsunterlagen

5.1.11. Auftragsunterlagen

Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch

Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen (oder Teile davon) offiziell verfügbar sind: Englisch

Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00)

Mitteuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Internetadresse der Auftragsunterlagen: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Bedingungen für die Einreichung:

Elektronische Einreichung: Erforderlich

Adresse für die Einreichung: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch

Elektronischer Katalog: Nicht zulässig

Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Zulässig

Frist für den Eingang der Angebote: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 180 Tage

Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:

Eröffnungstermin: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Ort des Eröffnungstermins: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Noch nicht bekannt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:

Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: The High Court of Ireland

Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: Education Procurement Service (EPS)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: The High Court of Ireland

Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Education Procurement Service (EPS)

Organisation, die Angebote bearbeitet: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Los: LOT-0002

Titel: Plasma Etcher ,Metals ,Piezoelectrics

Beschreibung: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Interne Kennung: 2

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Lieferleistungen

Haupteinstufung (cpv): 38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)

5.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): South-East (IE052)

Land: Irland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Laufzeit: 48 Monate

5.1.5. Wert

Geschätzter Wert ohne MwSt.: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Allgemeine Informationen

Vorbehaltene Teilnahme:

Teilnahme ist nicht vorbehalten.

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.9. Eignungskriterien

Quellen der Auswahlkriterien: Auftragsunterlagen

5.1.11. Auftragsunterlagen

Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch

Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen (oder Teile davon) offiziell verfügbar sind: Englisch

Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00)

Mitteuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Internetadresse der Auftragsunterlagen: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Bedingungen für die Einreichung:

Elektronische Einreichung: Erforderlich

Adresse für die Einreichung: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch

Elektronischer Katalog: Nicht zulässig

Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Zulässig

Frist für den Eingang der Angebote: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 180 Tage

Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:

Eröffnungstermin: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Ort des Eröffnungstermins: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Noch nicht bekannt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: nein

Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:

Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: The High Court of Ireland

Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: Education Procurement Service (EPS)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: The High Court of Ireland

Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Education Procurement Service (EPS)

Organisation, die Angebote bearbeitet: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Los: LOT-0003

Titel: Plasma Etcher ,Slow and Controllable Rate ,Atomic Layer Etch for Silicon , Dielectrics

Beschreibung: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork.

The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Interne Kennung: 3

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Lieferleistungen

Haupteinstufung (cpv): 38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)

5.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): South-East (IE052)

Land: Irland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Laufzeit: 48 Monate

5.1.5. Wert

Geschätzter Wert ohne MwSt.: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Allgemeine Informationen

Vorbehaltene Teilnahme:

Teilnahme ist nicht vorbehalten.

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.9. Eignungskriterien

Quellen der Auswahlkriterien: Auftragsunterlagen

5.1.11. Auftragsunterlagen

Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch

Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen (oder Teile davon) offiziell verfügbar sind: Englisch

Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00)

Mitteuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Internetadresse der Auftragsunterlagen: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Bedingungen für die Einreichung:

Elektronische Einreichung: Erforderlich

Adresse für die Einreichung: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch

Elektronischer Katalog: Nicht zulässig

Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Zulässig

Frist für den Eingang der Angebote: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 180 Tage

Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:

Eröffnungstermin: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Ort des Eröffnungstermins: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Noch nicht bekannt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: nein

Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:

Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: The High Court of Ireland

Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: Education Procurement Service (EPS)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: The High Court of Ireland

Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Education Procurement Service (EPS)

Organisation, die Angebote bearbeitet: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Los: LOT-0004

Titel: Plasma Deposition ,PECVD

Beschreibung: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Interne Kennung: 4

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Lieferleistungen

Haupteinstufung (cpv): 38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)

5.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): South-East (IE052)

Land: Irland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Laufzeit: 48 Monate

5.1.5. Wert

Geschätzter Wert ohne MwSt.: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Allgemeine Informationen

Vorbehaltene Teilnahme:

Teilnahme ist nicht vorbehalten.

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.9. Eignungskriterien

Quellen der Auswahlkriterien: Auftragsunterlagen

5.1.11. Auftragsunterlagen

Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch

Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen (oder Teile davon) offiziell verfügbar sind: Englisch

Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00)

Mitteuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Internetadresse der Auftragsunterlagen: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Bedingungen für die Einreichung:

Elektronische Einreichung: Erforderlich

Adresse für die Einreichung: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch

Elektronischer Katalog: Nicht zulässig

Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Zulässig

Frist für den Eingang der Angebote: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 180 Tage

Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:

Eröffnungstermin: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Ort des Eröffnungstermins: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Noch nicht bekannt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: nein

Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:

Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: The High Court of Ireland

Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: Education Procurement Service (EPS)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: The High Court of Ireland

Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Education Procurement Service (EPS)

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Education Procurement Service (EPS)

Registrierungsnummer: IE 6609370 G

Postanschrift: Castletroy Limerick

Stadt: Limerick

Postleitzahl: V94 DK53

Land, Gliederung (NUTS): Mid-West (IE051)

Land: Irland

E-Mail: info@educationprocurementservice.ie

Telefon: 000

Internetadresse: <https://www.educationprocurementservice.ie/>

Profil des Erwerbers: <https://www.educationprocurementservice.ie/>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt

Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt

Organisation, die Angebote bearbeitet

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: The High Court of Ireland

Registrierungsnummer: The High Court of Ireland

Abteilung: The High Court of Ireland

Postanschrift: Four Courts, Inns Quay, Dublin 7

Stadt: Dublin

Postleitzahl: D07 WDX8

Land, Gliederung (NUTS): Dublin (IE061)

Land: Irland

E-Mail: HighCourtCentralOffice@courts.ie

Telefon: +353 1 8886000

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: European Dynamics S.A.

Registrierungsnummer: 002024901000

Abteilung: European Dynamics S.A.

Stadt: Athens

Postleitzahl: 15125

Land, Gliederung (NUTS): Βόρειος Τομέας Αθηνών (EL301)

Land: Griechenland

E-Mail: eproc-esender@eurodyn.com

Telefon: +30 2108094500

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

10. Änderung

Fassung der zu ändernden vorigen Bekanntmachung

:

46fee6a2-f409-4cd6-80db-618a50fcc925-01

Hauptgrund für die Änderung

:

Aktualisierte Informationen

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 7a2067c1-5ebe-49f4-b53b-0f9595ac5fa3 - 02

Formulartyp: Wettbewerb

Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung

Unterart der Bekanntmachung: 16

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 13/07/2026 16:03:29 (UTC+01:00)

Mitteuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 488696-2026

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 134/2026

Datum der Veröffentlichung: 15/07/2026